

## ПОПРАВКИ

**Поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2018/1922 на Комисията от 10 октомври 2018 година за изменение на Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба**

(Официален вестник на Европейския съюз L 319 от 14 декември 2018 година)

На стр. 129 под вписване 3В001.f. подравняването на точки 3 и 4 се променя, както следва:

- вместо:* „3. Оборудване, специално проектирано за изработване на маски, притежаващо всички изброени по-долу характеристики:
- a. Отклонен фокусиран електронен лъч, йонен лъч или "лазерен" лъч; и
  - b. С която и да е от следните характеристики:
    1. Размер на пълната широчина на светлинното петно при половината от максимума (full-width half-maximum — FWHM) под 65 nm и позициониране на изображението под 17 nm (средна стойност + 3 sigma); или
    2. Не се използва;
    3. Отклонение в покритието при втория слой на маската под 23 nm (средна стойност + 3 sigma);
    4. Оборудване, проектирано за обработка на устройства, използващо методи за директен печат и имащо всички изброени по-долу характеристики:
      - a. Отклонен фокусиран електронен лъч; и
      - b. С която и да е от следните характеристики:
        1. Минимален размер на светлинния лъч, равен или по-малък от 15 µm; или
        2. Отклонение в покритието под 27 nm (средна стойност + 3 sigma);“
- да се четат:* „3. Оборудване, специално проектирано за изработване на маски, притежаващо всички изброени по-долу характеристики:
- a. Отклонен фокусиран електронен лъч, йонен лъч или "лазерен" лъч; и
  - b. С която и да е от следните характеристики:
    1. Размер на пълната широчина на светлинното петно при половината от максимума (full-width half-maximum — FWHM) под 65 nm и позициониране на изображението под 17 nm (средна стойност + 3 sigma); или
    2. Не се използва;
    3. Отклонение в покритието при втория слой на маската под 23 nm (средна стойност + 3 sigma);
    4. Оборудване, проектирано за обработка на устройства, използващо методи за директен печат и имащо всички изброени по-долу характеристики:
      - a. Отклонен фокусиран електронен лъч; и
      - b. С която и да е от следните характеристики:
        1. Минимален размер на светлинния лъч, равен или по-малък от 15 µm; или
        2. Отклонение в покритието под 27 nm (средна стойност + 3 sigma);“